



# カプセルフィルター プロファイル・ナノ

半導体CMPスラリー、カラーレジスト等の分散液ろ過フィルター



“プロファイル・ナノ”カプセルフィルターは、CMPスラリーのセラミアスラリー、低濃度のコロイダルシリカスラリーのろ過フィルターとして開発されました。半導体研磨工程のPOUフィルターとして、小型カプセルを準備し、特にSTI用、Cuバリア膜用の研磨工程でのPOUフィルターに適しています。使用されているメディアはこれまでのポールのメルトブロー技術を発展させた、より微細なファイバーを用い、100nmのろ過精度を保有しています。

## 特長

- より微細なファイバーによる連続したテーパー孔構造
- 各層で安定した孔径を持ち、正確なる過が可能
- メディアの移行、剥離がない。
- ポリプロピレン製の小型カプセルフィルター

## 利点

- テーパー孔構造による長いろ過寿命
- 高い集塵能力
- 分散ろ過において、高い分級効果
- 幅広い流体適合性

## 材質

構成部品		材質および継手
フィルターメディア		ポリプロピレン
その他の部品		ポリプロピレン
継手	入口／出口	NPT1/4インチ、フレアスタイル1/4インチ フレアスタイル3/8インチ
	ベント／ドレイン	NPT1/8インチ、フレアスタイル1/4インチ

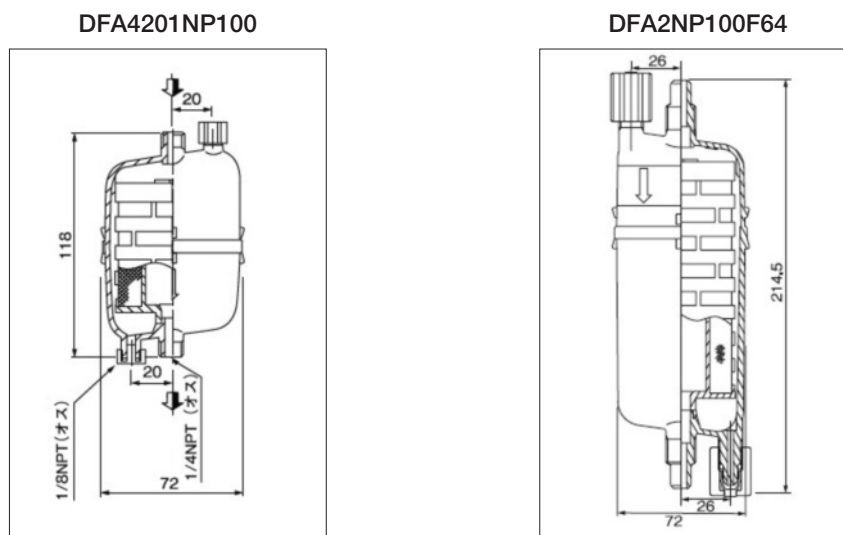
## 仕様

ろ過精度	100 nm
最高使用温度	40 °C
耐差圧 (温度条件°C)	0.5 MPa @ 25 °C 0.2 MPa @ 40 °C

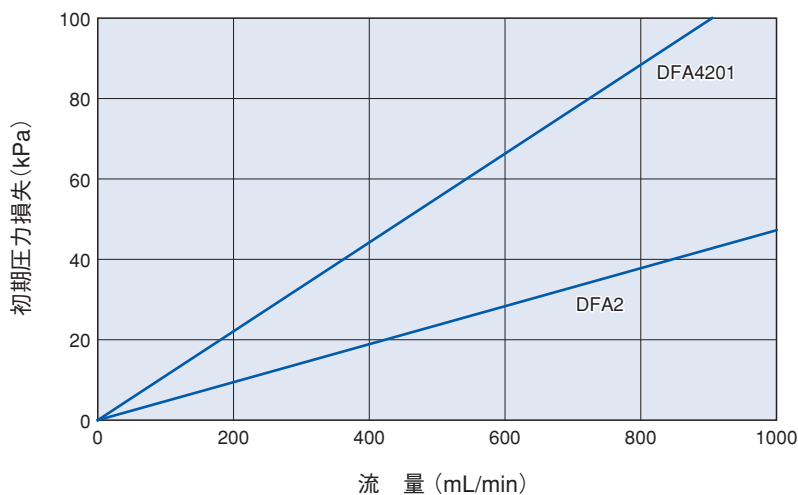
# プロファイル・ナノ カプセルフィルター

製品型式	継手構成
DFA4201NP100	入口/出口:NPT1/4インチ, ベント/ドレイン:NPT1/8インチ
DFA1NP100FL4N2	入口/出口:フレアスタイル1/4インチ, ベント/ドレイン:NPT1/8インチ
DFA2NP100FL64	入口/出口:フレアスタイル3/8インチ, ベント/ドレイン:NPT1/4インチ

## ■外形図



## ■流量－圧力損失特性(水、20°C)



## ■流体適合性

詳細につきましては、当社各営業所までお問い合わせください。

**PALL** 日本ポール株式会社

マイクロエレクトロニクス事業部  
〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1  
TEL.03 (6901) 5700

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。